(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. Mai 2004 (13.05.2004)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/040616 A3

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 51/20, 21/336, 29/786

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003673

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. Oktober 2003 (29.10.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 50 984.0 29. Oktober 2002 (29.10.2002) DI

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): HAHN-MEITNER-INSTITUT BERLIN GMBH [DE/DE]; Glienicker Str. 100, 14109 Berlin (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÖNENKAMP, Rolf [DE/US]; 1618 SW Laurel St., Portland, OR 97201 (US).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DK,

DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

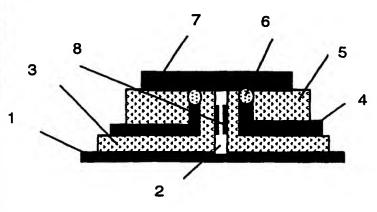
#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 22. Juli 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: FIELD EFFECT TRANSISTOR AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: FELDEFFEKTTRANSISTOR SOWIE VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG

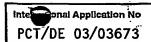


(57) Abstract: A field effect transistor is known in which at least one vertically arranged semiconductor column, with a diameter in the nanometre range, is located between a source and a contact and has an annular surround of a gate contact with retention of an insulation gap. A simplified production method is disclosed and the transistor produced thus is embodied such that the semiconductor columns (2) are embedded in a first and a second insulation layer (3, 5), between which a metal layer (4), running to the outside as a gate contact, is arranged, the ends of which, extending upwards through the second insulation layer (5), are partly converted into an insulator (6), or partly removed and replaced by an insulation material.

(57) Zusammenfassung: Es ist bereits ein Feldeffekttransistor vorgeschlagen worden, bei dem sich zwischen einem Source- und einem Drainkontakt mindestens eine vertikal ausgerichtete Halbleitersäule mit einem Durchmesser im Nanometerbereich befindet, die unter Belassung eines Isolationsabstandes ringförmig von einem Gatekontakt umgeben ist. Vorgeschlagen wird ein vereinfachtes Herstellungsverfahren. Der so hergestellte Transistor ist so aufgebaut, dass die Halbleitersäulen (2) in eine erste und eine zweite Isolierschicht (3, 5) eingebettet sind, zwischen denen sich eine als Gatekontakt nach aussen geführte Metallschicht (4) befindet, deren nach oben durch die zweite Isolierschicht (5) hindurchtretenden Enden teilweise in einen Isolator (6) umgewandelt oder teilweise entfernt und durch ein Isoliermaterial aufgefüllt sind.

004/040616 A3

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20 H01L21/336 H01L29/786

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic d	ata base consulted during the International search (name of data bas	e and, where practical, search terms used	
EPO-In	ternal, INSPEC		
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to dalm No.
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	vani passages	Helevalit to daili No.
Χ	DE 100 36 897 C (INFINEON TECHNOL	OGIES AG)	. 1
Α	3 January 2002 (2002-01-03) figures 1a-1c		2
P,X	US 6 515 325 B1 (DUESMAN KEVIN G	ET AL)	1
P,A	4 February 2003 (2003-02-04) figures 4a-af		2,7,8
A	US 2002/001905 A1 (CHOI WON-BONG	ET AL)	1,2
	3 January 2002 (2002-01-03) the whole document		
		-/	•
		•	·
			. •
	·		
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
° Special c	ategories of cited documents:	*T* later document published after the inte	ernational filing date
"A" docum	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention	
"E" earlier filing	document but published on or after the international date	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or canno	claimed invention
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or a is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the	cument is taken alone
"O" docum	on or other special reason (as specified)  nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an Ir document is combined with one or m	ventive step when the ore other such docu-
"P" docum	means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	ments, such combination being obvio in the art.  *&* document member of the same patent	
	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	
•	17 May 2004	26/05/2004	•:
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel 432 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Königstein, C	÷ .4

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interponal Application No
PCT/DE 03/03673

	MALEKIAN IONAL CEARCH RELOIT	PCT/DE 0	3/03673
C.(Continua	Ition) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	ENGELHARDT R ET AL: "Growth of compound semiconductors in nanometer sized channels of polymers" 2001, WARRENDALE, PA, USA, MATER. RES. SOC, USA, 17 April 2001 (2001-04-17), - 20 April 2001 (2001-04-20) pages 08.8.1-6, XP008030799 ISBN: 1-55899-608-7 the whole document		
-	_	·	
	···		

:::

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Interponal Application No PCT/DE 03/03673

	Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
	DE 10036897	С	03-01-2002	DE WO EP US	10036897 C1 0211216 A1 1305834 A1 2003132461 A1	03-01-2002 07-02-2002 02-05-2003 17-07-2003
	US 6515325	B1	04-02-2003	US	2003168683 A1	11-09-2003
: .··	US 2002001905	A1	03-01-2002	KR CN JP US US	2002001260 A 1330412 A 2002110977 A 2003230782 A1 2003227015 A1 2003230760 A1	09-01-2002 09-01-2002 12-04-2002 18-12-2003 11-12-2003 18-12-2003

**;** 

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interponales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03673

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/20 H01L21/336 H01L29/786 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der iPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, INSPEC C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie<sup>o</sup> DE 100 36 897 C (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 1 X 3. Januar 2002 (2002-01-03) Abbildungen la-lc ET AL) P,X US 6 515 325 B1 (DUESMAN KEVIN G 4. Februar 2003 (2003-02-04) 2,7,8 P.A Abbildungen 4a-af 1,2 US 2002/001905 A1 (CHOI WON-BONG ET AL) Α 3. Januar 2002 (2002-01-03) das ganze Dokument Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolitidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) O' Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00e4nahmen bezieht
 P' Ver\u00f6fentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdatum ver\u00f6fentlicht worden ist \*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 26/05/2004 17. Mai 2004 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Königstein, C

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interponales Aktenzelchen
PCT/DE 03/03673

1.30

	PCT/DE · 03/		<b>'03673</b>	
(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
	ENGELHARDT R ET AL: "Growth of compound semiconductors in nanometer sized channels of polymers" 2001, WARRENDALE, PA, USA, MATER. RES. SOC, USA, 17. April 2001 (2001-04-17), -20. April 2001 (2001-04-20) Seiten 08.8.1-6, XP008030799 ISBN: 1-55899-608-7 das ganze Dokument			
•				
		• ;		
		٠	·	
		ı		
		*		
		··		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interpolates Aktenzeichen
PCT/DE 03/03673

	echerchenbericht tes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	ı	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE	10036897	С	03-01-2002	DE WO EP US	10036897 C1 0211216 A1 1305834 A1 2003132461 A1	03-01-2002 07-02-2002 02-05-2003 17-07-2003
US	6515325	B1	04-02-2003	US	2003168683 A1	11-09-2003
US	2002001905	A1	03-01-2002	KR CN JP US US	2002001260 A 1330412 A 2002110977 A 2003230782 A1 2003227015 A1 2003230760 A1	09-01-2002 09-01-2002 12-04-2002 18-12-2003 11-12-2003 18-12-2003